

## 第 27 回コロイド・界面技術者フォーラム ～ コロイド領域の基礎および製剤技術 ～

**CONCEPT** コロイド・界面技術者フォーラムでは、第一線でご活躍されている先生をお招きし、じっくり話を伺う機会を提供しています。本年は、コロイド・界面化学分野の最新の製剤化技術と基礎理論に触れることで、コロイド・界面現象を深く理解する場をオンライン開催にて提供します。企業に所属する研究員が密に語り合い刺激し合える場を設けることで、視野の拡大・研究意欲の鼓舞・研究者ネットワーク形成等に貢献します。

会 期 令和 6 年 11 月 22 日(金) オンライン開催

### SESSION 1 講演

13:00-15:10 企業講師4名、アカデミア講師1名によるコロイド・界面現象に関する製剤化技術と基礎理論の紹介

13:05-13:30

#### 肌をこすらずメイクを落とす自発洗浄技術 の開発と応用

花王株式会社 スキンケア研究所  
長崎 裕子氏

メイクはしっかり落としたいけど肌はこすりたくないというメイク落としの根本的なストレスを解決するため、メイク落としを塗布してすぐだけで落としにくい持続性メイクが落ちるメイク自発洗浄技術の開発を行った。本講演では、メカニズム解析結果とメイク自発洗浄を引き起こす界面活性剤の特徴、開発品による顔での効果検証結果について紹介する。



13:30-13:55

#### ナノ化したワセリンの皮膚浸透性 及び保水効果の検証

富士フィルム株式会社  
バイオサイエンス&エンジニアリング研究所  
宇田 謙氏

皮膚角層のバリア機能や水分保持機能は、加齢や乾燥などの影響で低下する。我々は、保湿機能をこれまで以上に高める成分開発を目指し、保湿剤として広く使用されているワセリンに着目。これをナノ微細化して水系成剤への配合を可能にした。本講演では、ナノ化したワセリンによる皮膚浸透性及び保水効果の検証結果について紹介する。



13:55-14:20

#### スキンケア乳化技術を応用したスキンケア ファンデーションの開発検討

株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所  
高田 耕太郎氏

ベースメイクとしての機能をこれまで同等に持ちつつ、真の美容液感触や効果を有するスキンケアファンデーションの開発を狙い、水中油型エマルジョン系ファンデーションの処方構築を行うことにし設計するにあたり、スキンケア製剤において高い乳化安定性を示し、感触にも優れる既報のシリコーンナノディスク乳化系に着目し、開発検討を行った。



14:20-14:45

### レシチン逆紐状ミセルのレオロジー特性と組成が水溶性薬物の皮膚浸透に与える影響

ポーラ化成工業(株)フロンティア研究所  
宮坂 美行氏

本研究は、レシチン逆紐状ミセル(LRW)のレオロジー特性に着目し、水溶性薬物の毛包を介した皮膚浸透に及ぼす基剤の影響を明らかにすることを目的とした。様々な油中でLRWを形成することが報告されているが、皮膚適用可能な油での詳細な検討は少ない。まず、皮膚に塗布できる油剤の代表例として流動パラフィン(LP)を用いて、油剤の物理化学的性質やLRWの組成がLRWのレオロジー特性に及ぼす影響を調べた。次に、水溶性薬物のモデルとして蛍光物質である6-カルボキシフルオレセイン(CF)を配合したLRWのレオロジー特性と組成がCFの皮膚透過及び毛包浸透に与える影響を検討した。



14:45-15:10

### こめパラフィンでゲル化したオイルゲルの摩擦と触感

山形大学学術研究院  
野々村 美宗教授

化粧品業界ではSDGsの実現に貢献するために、天然由来材料の機能探索が進められてきた。われわれはこめヌカから抽出したこめパラフィンに注目し、この固体脂が流動パラフィン、シリコーン油など化粧品用油剤を固化することを確認した。このオイルゲルは摩擦係数が低く、滑らかな触感のゲルを形成することから、口紅やクレンジングバームへの応用が期待される。



## SESSION 2 ディスカッションタイム

15:25-16:55 ブレイクアウトルームに分かれた講師とのディスカッションタイム

※すべての講師とのディスカッションタイムがあります。

※ディスカッション時間 15分×5

## お申込み・参加費

### ■お申し込み方法

コロイドおよび界面化学部会 Web サイト

( [https://app.payvent.net/embedded\\_forms/show/66d993b16450df2670e09d0e](https://app.payvent.net/embedded_forms/show/66d993b16450df2670e09d0e) ) にアクセスし、お申込下さい。

※令和6年9月上旬受付開始、申込締切日:令和6年11月上旬 or 定員に達し次第(定員:40名)

### ■参加費(税込)

部会員 6,000円 日化・協賛学会員 9,000円 非会員 11,000円 学生 3,000円

※ご勤務先が法人部会員の場合は部会員、日本化学会法人会員の場合は日本化学会会員、協賛学会法人会員の場合は協賛学会員扱いとなります。

※協賛学会は、コロイドおよび界面化学部会 Web サイト( <http://colloid.csj.jp> ) よりご確認ください。

## お問い合わせ

日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 企業委員会

E-mail [tech@colloid.csj.jp](mailto:tech@colloid.csj.jp) 電話(03)3292-6163